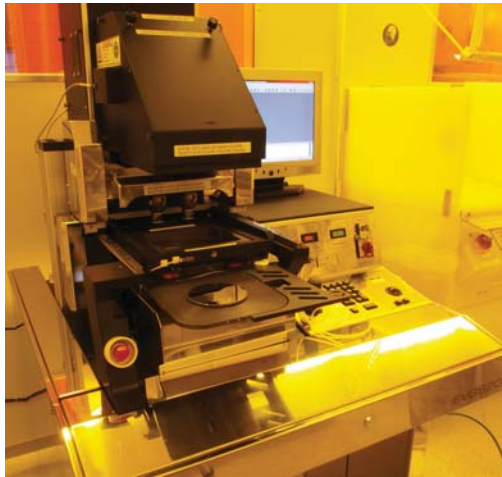


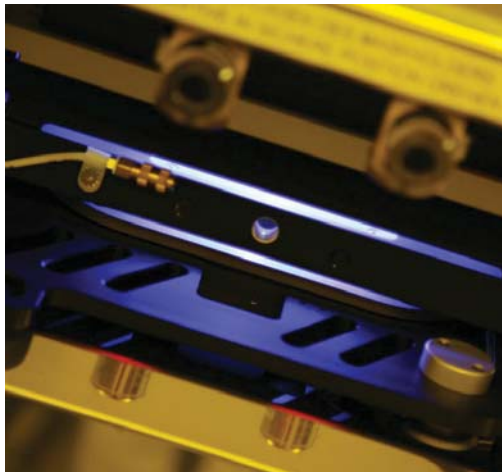
## MASKALIGNER

EVG 620



### ECKDATEN

Substratgrößen:	Rund Ø150 mm Quadratisch 150 mm x 150 mm
Quelle:	HBO-Lampe 1000 W
Masken:	Folien- und Glasmasken
Alignment:	Top- oder Bottomalignment
Belichtungsmodi:	Constant Dose / Power / Intensity & Flutbelichtung
Kontaktmodi:	Proximity, Softcontact, Hardcontact, Vacuumcontact
Aligniergenauigkeit:	bis zu 1 µm
Strukturauflösung:	bis zu 1 µm



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Belichtung von Positiv- und Negativresist
- Alignment von Substraten für Bondprozess auf EVG 520
- Nano-Imprint-Lithografie / UV-Embossing
- Prozesse für div. Photoresiste:  
AZ1512, AZ4562, AZ9260,  
S1805, S1813, S1828,  
SU8, Ordyl alpha, Ti35 (S), ...
- Foturan



### NANO-IMPRINT-LITHOGRAFIE

Möglichkeit, beliebige Anzahl an 2.5D-Strukturen im Nanometer-Bereich über einen Fertigungsschritt herzustellen.

Direkte Master:	Phasenmaske, Gratings, Mikrolinsen
Indirekt:	via Abguss mit PDMS
Materialien:	Ormocere, UV-härtende Polymere